

知的財産報告書

東京エレクトロンのコア技術は、半導体及びFPD製造のためのプロセス技術及びメカトロニクス技術であり、製品競争力強化のための技術開発を推進していますが、知的財産権による保護なくしては、独自開発の技術及び製品を自社のものと主張することができません。当社は知的財産戦略が、技術戦略及び製品戦略と三位一体となることによって初めて、期待した効果が最大限に発揮されると考えています。

また、昨今の半導体メーカーとの役割分業化により、装置のみならずプロセス、複数プロセスのインテグレーション、さらにはプロセスコントロールへと、当社の役割が拡張を続けることによる知的財産権保護の多様化に対しても、積極的にレシピ、ソフトウェア特許出願などによる対応を行うことで、保護強化に努めています。

ライセンス関連活動の事業への貢献

当社は自社開発製品や開発技術について、出願・権利化に成功した知的財産権を競合他社にライセンスアウトすることで収益を上げるのではなく、自社製品における技術的差別化や競争優位性確保を重点として、知的財産戦略を構築・実行しています。技術がますます高度化、複雑化している半導体及びFPD製造装置分野では、最先端技術を導入した新製品を効率良く開発し早期に市場投入するために、あらゆる知的財産権を有効に活用することが必要です。当社は、最先端技術の導入、研究開発効率の向上、新製品の早期市場投入を重視し、自社開発による知的財産の利用と同様に他社の知的財産を尊重し、ライセンスインなどを行うことで有効活用しています。

今後は、自社保有の知的財産権によっては当事業領域外の第三者や協業パートナーへの譲渡やライセンスなども検討していく予定です。

知的財産の取得・管理、営業秘密管理、技術流出防止に関する方針

当社においては、「知的財産権に関する規程」で知的財産権の取り扱いについて定めています。この規程に従って、発明・考案・創作者には、特許、実用新案、意匠などの出願時一時金、社内実施、ライセンスなどの社外実施の実績に応じた補償金を支払うこととなっていま

す。また、上述の実績補償金のほかに、技術者による発明・考案・創作への意欲向上のため、優秀発明賞などの発明報奨制度を制定しています。

今年度より施行されている改正特許法の趣旨に基づき、上述の実施補償制度・発明報奨制度をより判りやすく、かつ発明者の貢献を厚遇する制度に改定すべく、平成16年9月の「新職務発明制度における手続き事例集(特許庁発行)」で定められている内容と同等となるように検討中です。

営業秘密などは、「技術・営業情報管理規程」及び「技術・営業情報管理運用マニュアル」に基づいて厳密に管理されており、「営業秘密管理指針」及び「技術流出防止指針」で定められる内容とほぼ同等の管理内容となっています。

また、資材・調達部門との連携強化により、部品レベルでの海賊品対策を強化しています。本活動は、日本国内のみならず、米・アジア諸国に対して現地の法律事務所と連携し、今後その範囲を広げていく予定です。

知的財産権の出願状況

2005年3月末日時点での、当社の国内外における特許出願状況は下表のとおりです。既に、全体的には国内外への特許取得の厳選化を進めていますが、各事業分野における製造拠点・市場を考慮し日本を含む出願国の見直しを実施しています。

また、過去数年間の施策であった米国への出願強化のほか、今後は中国、韓国、台湾などのアジア地域で出願強化を行っていく予定です。

